講 座

# 内殻励起をともなう非弾性散乱をもちいた電子構造異方性解析

# Observation of Anisotropy of Electronic Structures by Using Anisotropy of Inelastic Scattering Accompanied by Inner-Shell Excitation

齋藤晃 Koh Saitoh

名古屋大学エコトピア科学研究所

要旨本稿では、電子線エネルギーフィルターをもちいて得た2次元非弾性散乱分布からフェルミレベル近傍の非占有状態の電子軌道の 異方性を解析する手法を紹介する.まず、電子軌道の異方性が非弾性散乱図形にどのように現れるかを、グラファイトの |ls>→|π\*) 遷移をともなう非弾性散乱図形を例に挙げて解説し、われわれが行っている部分状態密度解析法を紹介する.この手法では、エネ ルギー損失を変化させながら取得した一連の内殻励起非弾性散乱図形に対して、励起終状態として可能な電子軌道をもとに計算し た散乱図形を基底関数として成分分離を行い、部分EELSスペクトルを取得する.最後に、本手法の応用例として、カーボンナノチュー ブおよび超伝導物質 MgB<sub>2</sub>におけるσ,π成分の部分 EELSスペクトルの取得について、および高温超伝導体 Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub> における *d*ホールの異方性の解析について紹介する.

キーワード:電子線非弾性散乱,角度分解 EELS,エネルギー選択回折,電子軌道異方性,部分状態密度

### 1. はじめに

銅酸化物高温超伝導体における CuO<sub>2</sub> 面上の d 電子,強相 関遷移金属酸化物における軌道配向秩序,グラフェン等の低 次元系におけるディラック粒子など,特異な物理現象が電子 構造の異方性と絡み合う例が数多くみられる.固体のさまざ まな物性の発現にはフェルミレベル近傍の電子が重要な役割 を担っているため,それらの電子構造の異方性を明らかにす ることは極めて重要である.電子構造の異方性を観察する手 法としては,偏極 X 線吸収,共鳴 X 線非弾性散乱,角度分 解光電子分光,角度分解電子エネルギー損失分光(EELS)な どがあり,目的や試料の状態に応じて使い分けられている. なかでも角度分解 EELS は,電子顕微鏡の高空間分解能ミク ロスコピーおよびディフラクトメトリーの機能を利用しなが ら,試料の数 10 ナノメーターの領域を選択してデータ取得が できるため,ナノ材料に対する極めて強力な分析手段である.

角度分解 EELS は、そのデータ取得法により2つに分類される.ひとつは、対物絞り等で特定の運動量移送(q)のみ を選択して EELS スペクトルを取得する方法である<sup>1~6)</sup>.こ の方法は、結像機能をもたない分光専用器でも行うことがで きるため、簡便な方法として以前より用いられてきた.分光 器のエネルギー分解能をそのまま生かして EELS スペクトル を取得できるという利点があるものの、角度分解能が低く、

 〒 464-8603 名古屋市千種区不老町 TEL/FAX: 052-789-3596
 E-mail: saitoh@esi.nagoya-u.ac.jp
 2012 年 11 月 1 日受付 q依存性の定量解析には適していない.

角度分解 EELS を行うもうひとつの方法は、結像機能の付いた分光器をもちいる手法である. Leapman らは Wien フィ ルターをラインフォーカス条件、すなわちエネルギー分散方 向と垂直方向に q 空間 (の1次元方向)が結像する条件に 調整し、グラファイトおよび六方晶 BN の  $\pi^*$ および  $\sigma^*$  軌道 の異方性に起因する EELS スペクトルの異方的 q 依存性を観 察した<sup>7)</sup>. その後、Botton らは、エネルギーフィルター装置 をもちいて特定のエネルギー損失電子による 2 次元的非弾性 散乱強度分布を観察する手法を報告した<sup>8)</sup>. 彼らは、電子線 の入射方向から c 軸が傾斜したグラファイト試料をもちい て、K 殻励起をともなう非弾性散乱の q 依存性が、終状態の 異方性を反映して異方的になることを観察した. この方法は 絞り法やラインフォーカス法に比べてエネルギー分解能は低 いものの、高い 2 次元角度分解能を有するため q 依存性の 定量解析に極めて有効である.

本稿では、エネルギーフィルターをもちいて得た2次元非 弾性散乱分布からフェルミレベル近傍の非占有状態の電子軌 道の異方性を解析する手法を紹介する.まず非弾性散乱断面 積の導出を行い、電子軌道の異方性が非弾性散乱図形にどの ように現れるか示す.その後、われわれが行っている部分状 態密度解析法を紹介し、それを適用した例<sup>9~11)</sup>を紹介する.

#### 2. 内殻電子励起をともなう非弾性散乱

試料に入射した高速電子が試料のさまざまな素励起をとも ない非弾性散乱する場合,その非弾性散乱の微分散乱断面積 は第一 Born 近似で以下のように表される<sup>12,13</sup>.

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE}(\mathbf{q}, E) \propto \frac{1}{q^4} \left| \left\langle f \left| \exp(i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}) \right| i \right\rangle \right|^2 \tag{1}$$

ここで、qは入射電子線から試料への運動量移送であり、 $|i\rangle$ および $|f\rangle$ は素励起の始状態および終状態である.内殻電子 励起の場合、始状態は $|1s\rangle$ 、 $|2p_x\rangle$ など原子軌道の波動関数 と近似できるため、微分散乱断面積のq依存性の異方性か ら終状態の異方性が抽出できる.高速電子の入射波数ベクト ル $k_0$ 、散乱後の波数ベクトルk'および運動量移送 $q = k_0 - k'$ の幾何学的関係を図1(a)および1(b)に示す.エネルギー 損失  $E = \hbar^2 (k_0^2 - k'^2)/2m$  での非弾性散乱過程に対して、散 乱電子の波数ベクトルk'の終点は半径k' = |k'|の球面S'を 描く.運動量移送qの始点を原点Oに平行移動すると、そ



図1 (a) 内殻励起をともなう電子線非弾性散乱の模式図. こ こではグラファイトの C-K 殻励起をともなう非弾性散乱過程 を示している. (b) 散乱の波数ベクトルの幾何学的関係. (c) 運 動量移送 q の始点を原点 O に平行移動したとき,その終点が 描く軌跡は原点から  $\mathbf{k}_0 \theta_{\varepsilon}$ だけ離れた球面 S"となる. (d) 非弾 性散乱の散乱因子  $\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE}$ (q, E) の3次元分布と実験で得られる 非弾性散乱図形の関係. 非弾性散乱図形は S"による断面とし て与えられる. (e) 運動量移送 q と p 軌道の極大方向 p の方 位関係.

の終点の軌跡は, 原点 O から  $\mathbf{k}_0 \theta_E$  だけ入射波数ベクトル方 向にずれた球面 S"を描く(図1(c)). ここで $\theta_E$ は特性角 と呼ばれ $\theta_E = E/2\gamma E_0$ (yは相対論補正因子 $\sqrt{1-(v/c)^2}$ ,  $E_0$ は 入射電子のエネルギー)で与えられる.このことから,実験 で得られるエネルギー選択非弾性散乱図形は,3次元 q 空間 の関数である $\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE}$ (q,E)の球面 S"による断面として得ら れることがわかる(図1(d)).この状況は,弾性散乱の回折 図形が結晶構造因子の Ewald 球による断面として与えられ ることに対応している.

**q**·**r** << 1 であることおよび始状態と終状態の直交性から, 式(1) は双極子遷移の形に書き換えられる.

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE}(\mathbf{q}, E) \propto \frac{1}{q^4} \left| \left\langle f \left| i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} \right| i \right\rangle \right|^2 \tag{2}$$

たとえば炭素 K 殻励起の場合,始状態が s 対称性を有する ため,終状態は p 状態のみが許される.ls および 2p 状態の 原子軌道の波動関数をもちいて式(2)を計算すると,以下 の式が得られる(付録参照).

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE}(\mathbf{q}, E) \propto \frac{1}{q^4} (\mathbf{q} \cdot \mathbf{p})^2 = \frac{p_z^2}{q^4} = \frac{1}{q^2} \cos^2\beta$$
(3)

ここで $\mathbf{p}$ はp軌道の振幅が最大となる方向を指す単位ベクト ルであり、 $\beta$ は運動量移送 $\mathbf{q}$ と $\mathbf{p}$ のなす角である(図1(e) 参照).

図 2 (a), 2 (b), 2 (c), 2 (d), 2 (e) および 2 (f) は,始 状態および終状態をs 軌道および p 軌道とし,  $q_h$  軸を回転軸 としてそれぞれ  $\alpha = 0^\circ$ , 30°, 60°, 90°, 120° および 150° として 計算した非弾性散乱図形である.入射電子線のエネルギーを 300 keV,エネルギー損失を 300 eV とした.相対論効果は Fanoの因子<sup>14,15)</sup>を乗じることにより取り入れている. $\alpha = 0^\circ$ でみられる等方的なピークが、 $\alpha$ が増大するにしたがって  $q_v$ 方向にずれて異方的となる. $\alpha = 60^\circ$ ではメインピークの下 方に 2 つ目のピークがみられ、 $\alpha = 90^\circ$ で 2 つのピークが対



図2 始状態および終状態をそれぞれs軌道およびp軌道として計算した非弾性散乱図形.右下の角度はp軌道の振幅が最大となる向きpと電子線入射方向 $k_0$ のなす角度を表す.p軌道の回転軸は水平方向である.



図3 グラファイト試料から得た1sからπ\*への励起をともなう非弾性散乱図形.右下の角度はグラファイトのc軸と電子線の入射方向のなす角度を表す.

称になる.  $\alpha = 90^{\circ} を超えると下側のピークが増大し、上側$  $のピークが減少する. さらに <math>\alpha$ を増大させると、下側のピー クのみとなり、 $\alpha = 180^{\circ}$ では、 $\alpha = 0^{\circ}$ と同じ強度分布となる. 図3(a)、3(b)、3(c) および3(d)は、グラファイト試料 から得た ls から  $\pi^*$  への励起をともなう非弾性散乱図形であ る. それぞれ  $\pi^*$  軌道が  $\alpha = 15^{\circ}$ , 30°, 45° および 90° となるよ うに試料を傾斜して得た. 図2のシミュレーションでみら れた特徴がみられることがわかる.

# 3. 解析手法

実験で得られる非弾性散乱図形は,式(3)で与えられる 非弾性散乱断面積とバックグラウンドの和であると考えられ る.もし同じエネルギー損失で遷移する終状態が複数存在し ていれば,非弾性散乱図形はそれらの重ね合わせとなるであ ろう.本研究ではそれらの干渉を無視してインコヒーレント な和とする.例えば,グラファイトのK殻励起の場合,ls 始状態からの終状態として可能な状態は $\sigma$ \*状態および $\pi$ \* 状態があるが,非弾性散乱図形は以下のような線形結合で表 されると考える.

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE} = a_{\sigma} \left. \frac{d^2\sigma}{d\Omega dE} \right|_{s\to\sigma} + a_{\pi} \left. \frac{d^2\sigma}{d\Omega dE} \right|_{s\to\pi} + b(\mathbf{q}, E) \tag{4}$$

ここで, b(q,E) はバックグラウンドである.

バックグラウンドb(q, E)は、吸収端より低いエネルギー 損失でみられる非弾性散乱図形(プレエッジ図形)と同じq依存性を有する成分とq依存性のない平坦な成分を仮定し た.本研究ではq依存性を有する成分として、吸収端より 数10 eV 低い領域で得た非弾性散乱図形にべき型( $AE^{\tau}$ )の 減衰因子を与えてもちいた<sup>14)</sup>.バックグラウンドの平坦成分 は、CCD カメラの平坦なノイズ等を除去するために導入し た.

パラメーターの決定には、以下で定義される残差自乗和を

最小にするよう非線形最小自乗フィッティング法を用いた.

$$\chi^{2} = \sum_{i} \frac{\left(I_{i}^{\exp} - I_{i}^{\sin}\right)^{2}}{w_{i}^{2}}, \qquad (5)$$

ここで、 $I_i^{exp}$ ,  $I_i^{sm}$  および $w_i$ はi番目の画素の実験強度、計 算強度およびi番目のデータの標準偏差である。検出器での 電子計測を Poisson 過程と仮定して $w_i$ は  $\sqrt{I_i^{exp}}$  で与えた。 $\chi^2$ の積算範囲は、周囲の Bragg スポットの裾野からの影響がな いよう最隣接 Bragg スポットまでの半分とした。たとえば、 MgB<sub>2</sub>の場合、この値は約6 mrad であり、その内側には 10000 点以上の画素が含まれる。

#### 4. 実 験

非弾性散乱図形の取得には、オメガフィルターを搭載した 透過電子顕微鏡 JEOL JEM-2010FEF および GIF を搭載した 透過電子顕微鏡 FEI Tecnai G30 Polara をエネルギー選択回折 モードで使用した.加速電圧は 100 kV ~ 300 kV とした.エ ネルギー選択幅を 1 ~ 5 eV とし、各吸収端でエネルギー損 失を 1 ~ 5 eV ステップで変化させながら非弾性散乱図形を 取得した.非弾性散乱図形の取得には、画素数 1024 × 1024 の CCD カメラを 512 × 512 にビニングしてもちいた.各図 形の撮影時間は 30 秒とした.散乱角の較正には同じカメラ 長で撮影した弾性散乱の回折図形に見られる回折点の位置を もちいた.試料は、多層カーボンナノチューブ、MgB<sub>2</sub>、 Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CuCa<sub>2</sub>O<sub>8</sub>をもちいた.いずれも、乳鉢で粉砕し、エタノー ル中に分散させたのち、マイクログリッドに滴下し、電顕試 料とした.

#### 5. 電子軌道異方性の定量解析

#### 5.1 カーボンナノチューブ

カーボンナノチューブ (CNT) は、 グラフェンが筒状になっ た構造をしている. 電子構造は基本的にグラファイトと同じ であり、各C原子の2s,  $2p_x$ および $2p_y$ 電子は $sp^2$ 混成軌道を 形成し、隣接C原子との結合を形成している. 残された $2p_z$ 電子は振幅極大方向をシート垂直方向に向け、π結合を形成 する.  $\sigma$ 軌道はグラフェンシートに平行に、π軌道はシート に垂直方向に配向しているため、シートが筒状に丸まってい ることに対応して、軌道の向きはチューブ軸の周りで回転し ている.

 $p_{z}$ 軌道(π軌道)は、図4(a)に示したようにチューブの 中心から放射状に配向している.チューブ軸に沿う方向をx軸とすれば、 $p_{z}$ 軌道の向きpは図1(c)のαをもちいてp =(0, sina, cosa)と表せる. π軌道への遷移をともなう非弾性 散乱図形は、αを0°から360°まで変化させながら得られる 非弾性散乱図形の和になる.



図4 カーボンナノチューブのチューブ軸方向から投影した  $\pi$  軌道 (a) および  $\sigma$  軌道 (b) の配列の模式図.

$$\frac{d^2 \sigma_{\pi}}{d\Omega dE} \propto \int_0^{2\pi} \frac{(\mathbf{q} \cdot \mathbf{O})^2}{q^4} d\alpha$$

$$= \frac{1}{q^4} \int_0^{2\pi} (q_y \sin \alpha + q_z \cos \alpha)^2 d\alpha$$

$$= \pi \frac{q_y^2 + q_z^2}{q^4}$$

$$= \pi \frac{\theta_y^2 + \theta_E^2}{k_0^2 (\theta_x^2 + \theta_y^2 + \theta_E^2)^2}$$
(4)

 $\sigma$ 軌道には $s, p_x$ および $p_y$ が含まれるが、K殻励起の場合、 双極子近似からs軌道は終状態として無視でき、 $p_x$ および $p_y$ への遷移のみを考慮すればよいことになる. $p_x$ 軌道の向きは チューブ面上のどの位置でも $\mathbf{p} = (1, 0, 0)$ で一定であるため、  $p_x$ への遷移をともなう非弾性散乱図形は以下の積分で得られ る.

$$\frac{d^2 \sigma_{\rho x}}{d\Omega dE} \propto \int_0^{2\pi} \frac{(\mathbf{q} \cdot \mathbf{O})^2}{q^4} d\alpha$$

$$= \frac{1}{q^4} \int_0^{2\pi} q_x^2 d\alpha$$

$$= 2\pi \frac{q_x^2}{q^4}$$

$$= \pi \frac{2\theta_x^2}{k_0^2 \left(\theta_x^2 + \theta_y^2 + \theta_E^2\right)^2}$$
(5)

また、 $p_y$ への遷移をともなう非弾性散乱図形は、 $p_z$ と同様に チューブ表面に沿ってx軸のまわりに回転しているため (図 4 (b) 参照)、式(4) と一致することがわかる. したがっ



図5 式(4) および(6) で与えられる非弾性散乱図形の強度 分布.(a) ls から π\* への遷移をともなう非弾性散乱図形.(b) ls から σ\* への遷移をともなう非弾性散乱図形.(c)(a) と(b) の和の図形.等方的な強度分布を示している.



図6 カーボンナノチューブの C-K 殻励起 EELS スペクトル.

て、σ軌道への遷移をともなう非弾性散乱図形は、式(4) と式(5)の和で与えられる.

$$\frac{d^2\sigma_{\sigma}}{d\Omega dE} \propto \frac{2\theta_x^2 + \theta_y^2 + \theta_E^2}{\left(\theta_x^2 + \theta_y^2 + \theta_E^2\right)^2}.$$
(6)

となる.

図 5 (a) および 5 (b) は、式 (4) および (6) で与えられる非 弾性散乱図形の強度分布である.ここで、CNT のチューブ 軸は水平方向とした.式 (4) および (6) の和は、図 5 (c) で 与えられるような等方的な強度分布である.このことは、  $|p_r\rangle + |p_r\rangle + |p_r\rangle$ が球対称の分布を示すことと符号する.

図 6 は CNT の C-K 殻励起 EELS スペクトルである. 285 eV に 1s から  $\pi^*$  への遷移による鋭いピークを示し, 296 eV に 1s から  $\sigma^*$  への遷移によるピークがみられる.図7 (a),7(b),7(c) および7(d) は,それぞれエネルギー損失 275 eV, 285 eV, 293 eV および 297 eV で得た非弾性散乱図形 である.チューブ軸は  $q_h$  方向(図の水平方向)に平行である. エネルギー損失 275 eV の図形は、非常に弱い等方的なピー クを示している.エネルギー損失 285 eV での図形は、 $q_v$  方 向への伸びおよび  $q_h$  方向にくびれを示し、明瞭な異方性を 有している.エネルギー損失 293 eV での図形は、ふたたび 等方的な強度分布を示している.矢印で示す弱いピークはグ ラファイトの 0002 回折点である.エネルギー損失 297 eV で の図形は、 $q_h$  方向に沿った伸びを示している.( $q_h, q_v$ ) = (0,0) にみられるピークは、どの図形でもチューブ軸に平行および



図7 カーボンナノチューブからエネルギー損失 275 eV (a), 285 eV (b), 293 eV (c) および 297 eV (d) で得た非弾性散乱 図形.チューブ軸は図の水平方向を向いている.



図8 本手法で得たカーボンナノチューブの部分 EELS スペク トル.

垂直な鏡映対称を示している. これは入射方向からみた  $\sigma$ 軌道および  $\pi$  軌道の投影対称性を反映している. 実際, こ の実験では CNT 試料のチューブ軸が電子線入射方向にほぼ 垂直であり,したがって  $\sigma$  軌道および  $\pi$  軌道は入射方向に 対して鏡映対称をもつように配向している.

CNT の C-K 殻励起において終状態は  $\sigma$  状態と  $\pi$  状態が可能であるため、(6) 式と同様の式を仮定し、線形結合係数  $a_{\sigma}$   $a_{\pi}$  およびバックグラウンドを非線形最小自乗フィッティ ングにより決定した.エネルギー損失 285 eV から 330 eV ま での散乱図形に対して定量解析を行い、 $\sigma$  成分および  $\pi$  成分 の線形結合係数を決定した結果を図8に示す.ここで  $\sigma^*$  成 分および  $\pi^*$  成分はそれぞれ実線および破線で表した.この 実線および破線のプロファイルは、C-K 殻から  $\sigma^*$  状態およ び  $\pi^*$  状態への遷移をともなう非弾性散乱断面積をエネル



図9  $MgB_2$ の結晶構造 (a), B o sp 電子による  $\sigma$  軌道 (b) および  $\pi$  軌道 (c).



図10 第一原理計算で得た  $MgB_2 \circ \sigma \kappa l$ なん 態密度.

ギー損失の関数として表したものであり,部分 EELS スペク トルと呼ばれるものである.この部分 EELS スペクトルは σ 状態および π 状態の部分状態密度 (pDOS) が多重非弾性散 乱等の効果で変調されたものと考えられる.実際,今回得た 部分 EELS スペクトルは,吸収端の立ち上がりから 20 eV 程 度までの範囲については,グラファイトの電子構造の理論計 算と非常に良い一致を示している<sup>16,17)</sup>. 294 eV より大きいエ ネルギー損失ではプラズモン等が関係する多重非弾性散乱過 程が関与していると考えられる<sup>18)</sup>.ただし,プラズモン励起 をともなう多重非弾性散乱は,内殻励起と比べて角度広がり が小さいため,散乱強度分布をそれほど大きく変化させな い<sup>19)</sup>.さらに詳細な解析には,励起状態を考慮して計算した pDOS との比較が必要であろう.

#### 5.2 超伝導体 MgB<sub>2</sub>

MgB<sub>2</sub>は、2001年に秋光らのグループにより $T_c$ =39Kで超 伝導転移を示すことが発見され、金属系で最も高い超伝導転 移温度を示す物質として注目された<sup>20)</sup>. 六方晶系に属してお り(図9参照)、フェルミ準位付近のp状態の異方性が理論 計算および実験により示唆されている<sup>21,22)</sup>. 図10はスピン 軌道相互作用を取り入れていない GGA 交換相関ポテンシャ ルをもちいた VASP<sup>23)</sup>をもちいて計算した MgB<sub>2</sub>のσおよび π状態の部分状態密度(pDOS)である. フェルミ面近傍の



図 11 MgB<sub>2</sub>の B-K 殻励起 EELS スペクトル.

状態密度は、おもに B の 2s,  $2p_x$  および  $2p_y$  電子による  $sp^2$ 混成軌道による  $\sigma$  バンドと  $p_z$  による  $\pi$  バンドから構成され ている.  $\sigma$  バンドはフェルミレベル上に幅 5 eV のギャップ を形成しているのに対し、 $\pi$ 軌道はフェルミレベル近傍で一 様に広がった金属的な特徴を示している. キャリアドープに もとづく研究により、非占有  $\sigma$  バンドが MgB<sub>2</sub> の超伝導の発 現に重要な役割を担っていることが示唆されている. これま で角度分解 EELS をもちいた研究がいくつか報告され、電子 構造の異方性についての議論がなされている<sup>24~27)</sup>.

図 11 は、非弾性散乱図形を取得した入射条件で得た MgB<sub>2</sub>の B-K 殻励起 EELS スペクトルである。EELS スペク トルは 189 eV に最初の立ち上がり、190 eV から 192 eV に 低いプラトー、193 eV に第2の立ち上がり、196 eV から 208 eV にわたり緩やかなピークを示している。計算した pDOS との比較から、189 eV の立ち上がり部分は、 $\sigma(p_x p_y)$ 状態および  $\pi(p_2)$  状態の両方が寄与しており、196 eV からの 低いプラトーは  $\pi(p_2)$  状態, また 205 eV 付近の緩やかなピー クは  $\sigma(p_x p_y)$  状態がおもに寄与していると考えられる。

図 12 (a), 12 (b), 12 (c) および 12 (d) はそれぞれエネル ギー損失 180 eV, 190 eV, 198 eV および 204 eV で撮影した MgB<sub>2</sub>の非弾性散乱図形である. 180 eV での図形は,  $(q_{lv}, q_{v})$ = (0, 0) の位置に弱い等方的なピークを示している. エネル ギー損失 190 eV の図形は中心のピークは  $q_{v}$ 方向に伸びてお り, 内殻励起の終状態がおもに  $\pi$  対称性を有していること を示している. エネルギー損失 198 eV の図形は中心のピー クは等方的であり, 内殻励起の終状態は  $\sigma$ 状態および  $\pi$ 状 態が同じ割合だけ含まれていることを示唆している. エネル ギー損失 204 eV の図形は中心のピークがわずかに  $q_{h}$ 方向に 伸びており, 励起終状態がおもに  $\sigma$  対称性を有しているこ とを示唆している.

各終状態中のσ状態およびπ状態の量を表す係数を,最 小自乗フィッティングをもちいて決定した.最小自乗フィッ ティングにもちいたデータは散乱角が 5.8 mrad 以下の領域 である. この中に含まれるデータ点,すなわち CCD の画素 数は 11304 点である. この半径は最近接の Bragg 反射からの 裾引きの影響がないよう最近接 Bragg 角の半分とした.



図 12 エネルギー損失 180 eV (a), 190 eV (b), 198 eV (c) および 204 eV (d) で撮影した MgB<sub>2</sub>の非弾性散乱図形. (e) 190 eV の図形からプレエッジ図形を引いたもの. (f) 204 eV の図形からプレエッジ図形を引いたもの.

図 13 (a) は決定したパラメーターをエネルギー損失量の 関数としてプロットしたもの、すなわち部分 EELS (pEELS) スペクトルである.  $\sigma$ 成分は 189 eV に立ち上がりを示し、 191 eV までに低いプラトーを示し、195 eV から 206 eV に高 いプラトーを示す.  $\pi$ 成分は 189 eV に同様の立ち上がりを 示し、今回の測定範囲にわたり比較的一定のスペクトル強度 を示している. スペクトルの立ち上がり付近では  $\pi$ 成分が  $\sigma$ 成分より大きいものの、エネルギー損失 193 eV 以上では  $\pi$ 成分が  $\sigma$ 成分より小さい. この特徴は計算で得た pDOS と よく一致している.

つづいて、試料を [1120] 入射から傾斜し、動力学回折効 果が強く現れない入射条件で同様の解析を行った. 図 13 (b) は、そのオフチャンネリング条件で得た pEELS スペクトル である. スペクトル形状の基本的な特徴は図7(a) と同じで あるが、 $\sigma$ スペクトルの立ち上がりの位置に小さなピークが みられる. 計算でもとめた  $\sigma$  状態の pDOS にもフェルミレ ベル直上に幅 0.8 eV の非占有  $\sigma$  状態が存在しており、これ とよく対応している. チャンネリング条件による pEELS ス ペクトルの変化は、多重散乱の低減によるものと考えられる. 実際、MgB<sub>2</sub> の低次の反射の消衰距離は 20 nm 程度である. また、[1120] や [1010] などの低次の晶帯軸入射での動力 学計算から、低次の反射強度が厚さの増大にともない激しく



図 13 非弾性散乱図形の成分分離して得た部分 EELS スペクトル. (a) [1120] 入射. (b) オフチャンネリング条件.

振動することが確認できる.そのような動力学回折効果が非 弾性散乱強度を再分配させ,散乱図形に現れる σ 成分の検 出を困難にしていると考えられる.

# 5.3 高温超伝導体 Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>

Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>は, 銅酸化物高温超伝導体である. 図 14 (a) にその結晶構造を示す<sup>28)</sup>.結晶構造は層状ペロブスカイト 構造と呼ばれるものであり、Cu とOが2次元正方格子を組 んだ CuO2 面を有している. Cuのd 電子が超伝導の発現に 重要な役割を担っていると考えられており、様々な手法で の分析がなされている. Cu の 3d 状態は、周囲の酸素がつく る結晶場とJahn-Teller 歪みにより  $\{3d_{r^2-r^2}\}, \{3d_{3r^2-r^2}\},$  $\{3d_{xy}\}, \{3d_{yz}, 3d_{zx}\} の4つに分裂する (図 14 (b) 参照).$ CuとOの価数をそれぞれ +1 および -2 とすれば, 3d バンド には9個の電子と1個のホールが存在することになる.ホー ル状態はおもに  $3d_{r^2-v^2}$  状態であるため、 $3d_{r^2-v^2}$  軌道の異 方性を反映した非弾性散乱のq依存性が観察できると考え られる.Bi<sub>s</sub>Sr<sub>s</sub>CaCu<sub>s</sub>O<sub>s</sub>の電子構造の異方性については、 Fink らによる角度分解 EELS をもちいた研究がなされてい る<sup>6</sup>. 彼らは, O-K および Cu-L 吸収端スペクトルが著しい q依存性を示すことを見出した. O-K スペクトルの q 依存性 から,非占有状態中のpホールがおもにpxおよびp、状態で 占有されていること, また Cu-L 殻励起スペクトルの定量解 析から d ホール状態は約 88%が 3d<sub>x2\_v2</sub> 状態で占有されてい



図 14  $\operatorname{Bi}_2\operatorname{Sr}_2\operatorname{CaCu}_2\operatorname{O}_8$ の結晶構造 (a), Cu 3d 電子の準位 (b),  $3d_{r^2-r^2}$  および  $3d_{q,r^2-r^2}$  軌道 (c).

表 1 始状態 { $p_x, p_y, p_z$ } および終状態  $\left\{ 3d_{x^2-y^2}, 3d_{3x^2-y^2} \right\}$ の各組み合わ せに対する非弾性散乱の q 依存性.

終状態 始状態	$d_{_{3z^2-r^2}}$	$d_{x^2-y^2}$
<i>₽</i> <sub>x</sub>	$rac{1}{6}q_x^2$	$rac{1}{2}q_x^2$
₽ <sub>y</sub>	$rac{1}{6}q_y^2$	$rac{1}{2}q_y^2$
₽₂	$rac{2}{3}q_z^2$	0

ることを結論した.

ここでは Cu の 3d 軌道の異方性を観察するため、2p 状態 からの励起、すなわち L 殻励起をもちいる. L 殻は、スピン 軌道相互作用により  $L_1$ ,  $L_2$  および  $L_3$  に分裂しているが、こ のうち p 状態を含むのは  $L_2$  および  $L_3$  である.  $L_2$  および  $L_3$ には 3 つの p 軌道  $\{p_x, p_y, p_z\}$  が含まれるため、これら 3 つを 始状態とした内殻励起を考慮しなければならない. また終状 態を  $3d_{x^2-y^2}$  または  $3d_{3x^2-r^2}$  とした場合の各内殻励起非弾性散 乱図形の q 依存性は表 1 で与えられるものとなる(付録参 照).  $L_2$  および  $L_3$  における  $p_x$ ,  $p_y$  および  $p_z$  状態の存在割合 は等しく(付録参照)、したがって各非弾性散乱図形を同じ 重みで足し合わせれば良いこととなる.

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE}\Big|_{p=d_{3z^2-r^2}} \propto \frac{1}{q^4} \Big| \Big\langle d_{3z^2-r^2} \left| i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} \right| L_{2,3} \Big\rangle \Big|^2 \\
= \frac{1}{q^4} \frac{q_x^2 + q_y^2 + 4q_z^2}{6}$$
(6)

$$\frac{d^{2}\sigma}{d\Omega dE}\bigg|_{p \to d_{x^{2}-y^{2}}} \propto \frac{1}{q^{4}} \Big| \Big\langle d_{x^{2}-y^{2}} \Big| i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} \Big| L_{2,3} \Big\rangle \Big|^{2}$$
$$= \frac{1}{q^{4}} \frac{q_{x}^{2} + q_{y}^{2}}{2} \tag{7}$$

図 15 (a) および 15 (b) は $L_{2,3}$ 準位から $\left| 3d_{x^2-y^2} \right\rangle$ および



図 15 始状態を $L_{2,3}$ 準位,終状態を $\left|3d_{x^2-y^2}\right\rangle$  (a) および  $\left|3d_{3z^2-y^2}\right\rangle$  (b) として計算した非弾性散乱図形.電子線の入射 方向をc軸から 45 度傾斜した方向とした.



図 16  $Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$ から得た Cu-L 殻励起 EELS スペクトル である.

 $|3d_{3z^2-r^2}\rangle$ への内殻遷移をともなう非弾性散乱強度の q 依存 性を計算したものである. 電子線の入射方向は c 軸から 45 度傾斜した方向とした. ここでは,入射電子のエネルギーを 300 keV, エネルギー損失を 930 eV とし,相対論効果は Fano 因子により取り入れている.

図 16 は Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>から得た Cu-L 殻励起 EELS スペク トルである. 933 eV と 953 eV のピークはそれぞれ L,および L<sub>3</sub>内殻レベルからフェルミレベル直上の非占有状態への遷 移に対応する.図 17 (a) および図 17 (b) は、エネルギー損 失 925 eV および 933 eV で得た非弾性散乱図形である. 電子 線の入射方向は、c 軸から q, 軸のまわりに 45 度傾斜した方 向である. 図 17 (c) および 17 (d) は, 図 17 (a) および 17 (b) の図形から、エネルギー損失920eVの強度分布を冪型 (AE<sup>-\*</sup>)の減衰因子を考慮して差し引いたものである. 図 17 (d)の図形には横方向に伸びた三日月状の散乱図形がみられ る. この特徴は図 15(a)の図形と類似しており, Cuのdホー ルの状態はおもに d<sub>x2-x2</sub> 軌道から形成されていると考えられ る.実験図形をこれらの線形結合で表されると考え、その線 形結合係数を非線形最小自乗フィッティングにより求め、終 状態における $\left|3d_{x^2-y^2}\right\rangle$ と $\left|3d_{3x^2-r^2}\right\rangle$ の割合いを求めた. その 結果,フェルミレベル直上の非占有状態における  $|3d_{_{2^2}}_{_{2^2}}
angle$ の割合いは13±2%となった.この値は、Finkらの報告と



図 17 エネルギー損失 925 eV (a,c) および 933 eV (b,d) で 得た Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>の非弾性散乱図形. (c)および(d)はプレエッ ジ図形を差し引いたもの.

一致している.現在, $L_2$ ピークまでを含めた異方性解析か ら得られる部分 EELS スペクトルの Branching ratio について 検討を行っている.また,O-K 殻励起をともなう非弾性散乱 図形の異方性からp 軌道の異方性解析を進めている.

#### 6. まとめ

内殻励起をともなう非弾性散乱図形の異方性の定量解析か ら、フェルミレベル近傍の非占有状態の軌道対称性を決定す る手法を紹介した.内殻吸収端でエネルギー損失を変えなが ら取得した一連の非弾性散乱図形シリーズに対して、計算図 形を基底関数として成分分離を行うことにより部分 EELS ス ペクトルが取得できることを示した. これらの部分 EELS ス ペクトルはバンド計算と良い一致を示しており、今後さまざ まな試料に対する応用が期待される.本稿では述べなかった が、最近われわれは軌道秩序を示す Mn 酸化物に対して、本 手法による軌道異方性の可視化を試みている。また、実験的 に得られた非弾性散乱図形は内殻励起終状態の電子波動関数 を直接導出する手法についても検討している<sup>29)</sup>.本手法の現 状での問題点は、エネルギー分解能が1eV程度と低い点で ある.本手法の応用範囲を広げるためには、電子顕微鏡装置 および分光器の機械的および電気的安定性の向上、モノクロ メーターや冷陰極など単色性の高い電子銃の導入、浮遊電磁 場の低減などによりさらなるエネルギー分解能の向上が必要 である.

本研究を行うにあたり、永坂圭佑氏と桃井浩太氏には実験 および解析の面で、また田中信夫先生には研究全般にわたり サポートくださいました. この場を借りて感謝の意を表しま す.本研究の一部は科研費挑戦的萌芽研究 (No. 23654117) により行いました.

# 付録

本稿で取り上げた水素様原子の 1s, 2p, 3d 軌道の波動関数 は、以下のように表される<sup>30</sup>.

$$\begin{split} |1s\rangle &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right) \\ |2p_x\rangle &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{5}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{2a_0}\right) x \\ |2p_y\rangle &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{5}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{2a_0}\right) y \\ |2p_z\rangle &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{5}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{2a_0}\right) z \\ |3d_{3z^2 - r^2}\rangle &= \frac{1}{81\sqrt{6\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{7}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{3a_0}\right) (3z^2 - r^2), \\ |3d_{x^2 - y^2}\rangle &= \frac{1}{81\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{7}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{3a_0}\right) (x^2 - y^2) \end{split}$$

たとえば、 $|1s\rangle \rightarrow |2p_z\rangle$ の双極子遷移の行列要素 $\langle 2p_z | i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} | 1s \rangle$ は

$$\langle 2p_z | i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} | 1s \rangle = \iiint \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{5}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{2a_0}\right) z$$
$$\cdot i \left(q_x x + q_y y + q_z z\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right) dx dy dz$$

の積分から計算される.係数部分を無視し,積分変数 x, y お よび z を極座標表示に変換すると,

$$\langle 2p_z | i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} | \mathbf{1}s \rangle \propto \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \exp\left(-\frac{Zr}{2a_0}\right) r \cos\theta \\ \cdot i(q_x r \sin\theta \cos\phi + q_y r \sin\theta \sin\phi + q_z r \cos\theta) \\ \cdot \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right) r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi \\ = i \int_0^\infty r^4 \exp\left(-\frac{3Zr}{2a_0}\right) dr \int_0^\pi \cos\theta \sin\theta \\ \int_0^{2\pi} (q_x \sin\theta \cos\phi + q_y \sin\theta \sin\phi + q_z \cos\theta) d\theta d\phi \\ = i \int_0^\infty r^4 \exp\left(-\frac{3Zr}{2a_0}\right) dr \int_0^\pi 2\pi q_z \cos^2\theta \sin\theta d\theta \\ = i \frac{4\pi}{2} C_r q_z$$

となる. ここで,rについての積分値をC,とした. この式は,  $p_z$ 軌道を終状態と仮定する場合,行列要素は運動量移送qの z成分にのみ依存することを示している. 同様に, $p_z$ 軌道を 終状態と仮定する場合は、以下のような式が得られる.

$$\langle 2p_x | i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} | 1s \rangle = i \frac{4\pi}{3} C_r q_x, \ \langle 2p_y | i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} | 1s \rangle = i \frac{4\pi}{3} C_r q_y$$

ー般に任意の方位を向いたp 軌道が終状態である場合,その p 軌道の極大方向に平行な単位ベクトルをpとすれば(図1 参照),遷移行列要素は運動量移送qのp方向成分すなわち, q·pに依存する.したがって,微分散乱断面積は,式(3) で表されるものとなる.  $|2p\rangle \rightarrow |3d\rangle$ の双極子遷移の行列要素 も同様に計算でき,共通の係数を無視すれば,表1にまとめ たものとなる.

 $L_2$  および $L_3$  レベルは, 2p 軌道の線形結合として表される. 全角運動量およびそのz 方向成分の固有値をそれぞれJ およ び $J_z$  として,その固有状態を  $|J, J_z\rangle$  と表すと,また $L_3$  レベ ル (J = 3/2)の状態は以下のように与えられる<sup>31)</sup>.

$$\begin{split} \left|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right\rangle &= \sqrt{\frac{1}{2}}\left(|2p_x\rangle + i|2p_y\rangle\right)|\uparrow\rangle\\ \left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle &= \sqrt{\frac{1}{6}}\left(|2p_x\rangle + i|2p_y\rangle\right)|\downarrow\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|2p_z\rangle|\uparrow\rangle\\ \left|\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle &= \sqrt{\frac{1}{6}}\left(|2p_x\rangle - i|2p_y\rangle\right)|\uparrow\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|2p_z\rangle|\downarrow\rangle\\ \left|\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right\rangle &= \sqrt{\frac{1}{2}}\left(|2p_x\rangle - i|2p_y\rangle\right)|\downarrow\rangle \end{split}$$

また $L_2$  レベル (J = 1/2) の状態は以下のように与えられる.

$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle &= \sqrt{\frac{1}{3}} \left(|2p_x\rangle + i|2p_y\rangle\right)|\downarrow\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}|2p_z\rangle|\uparrow\rangle \\ \left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle &= -\sqrt{\frac{1}{3}} \left(|2p_x\rangle - i|2p_y\rangle\right)|\uparrow\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|2p_z\rangle|\downarrow\rangle \end{aligned}$$

ここで、  $|\uparrow\rangle$ および $|\downarrow\rangle$ は電子のアップスピン状態およびダウ ンスピン状態を表す.  $|2p_x\rangle$ ,  $|2p_y\rangle$ および $|2p_z\rangle$ の係数から、  $L_2$ および $L_3$ 状態における $|2p_x\rangle$ ,  $|2p_y\rangle$ および $|2p_z\rangle$ 状態の占有 率が等しいことが分かる.

献

文

- 1) Zeppenfeld, K.: Z. Phys., 211, 391–399 (1968)
- Nücker, N., Romberg, H., Xi, X.X., Fink, J., Gegenheimer, B. and Zhao, Z.X.: *Phys. Rev. B.*, **39**, 6619–6629 (1989)
- 3) Batson, P.E. and Chisholm, M.F.: Phys. Rev. B., 37, 635–637 (1988)
- 4) Browning, N.D., Yuan, J. and Brown, L.M.: *Ultramicroscopy*, 38, 291–298 (1991)
- Klie, R.F., Su, H., Zhu, Y., Davenport, J.W., Idrobo, J.-C., Browning, N.D. and Nellist, P.D.: *Phys. Rev. B.*, 67, 144508 (2003)
- Fink, J., Niicker, N., Pellegrin, E., Romberg, H., Alexander, M. and Knupfer, M.: *Phys. Rev. B*, 38, 1, 204–207 (2003)
- Leapman, R.D., Fejes, P.L. and Silcox, J.: *Phys. Rev. B.*, 28, 2361– 2373 (1983)
- Botton, G.A.: J. Electron Spectrosc. Rel. Phenom., 143, 129–137 (2005)

- Saitoh, K., Nagasaka, K. and Tanaka, N.: J. Electron Microsc., 55, 281–288 (2006)
- Saitoh, K., Momonoi, K., Tanaka, N. and Onari, S.: J. Appl. Phys., 112, 113920 (2012)
- 11) Saitoh, K., Momonoi, K. and Tanaka, N.: in preparation (2012)
- 12) Bethe, H.: Ann. Physik., 397, 325-400 (1930)
- 13) Inokuti, M.: Rev. Mod. Phys., 43, 297–347 (1971)
- 14) Fano, U.: *Phys. Rev.*, **102**, 385–387 (1956)
- Kurata, H., Wahlbring, P., Isoda, S. and Kobayashi, T.: *Micron.*, 28, 381–388 (1997)
- 16) Carlisle, J.A., Shirley, E.L., Terminello, L.J., Jia, J.J., Callcott, T.A., Ederer, D.L., Perera, R.C.C. and Himpsel, FJ.: *Phys. Rev. B*, 59, 7433–7445 (1999)
- 17) Painter, G.S. and Ellis, D.E.: Phys. Rev. B, 1, 4747-4752 (1970)
- 18) Kuzuo, R., Terauchi, M. and Tanaka, M.: Jpn. J. Appl. Phys., 31, L1484–L1487 (1992)
- Egerton, R.F.: Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope. 2nd ed., Plenum Press, New York (1996)
- Nagamatsu, J., Nakagawa, N., Muranaka, T., Zenitani, Y. and Akimitsu, J.: *Nature*, 410, 63 (2001)
- 21) Kortus, J., Mazin, I.I., Belashchenko, K.D., Antropov, V.P. and Boyer, L.L.: *Phys. Rev. Lett.*, **86**, 4656 (2001)
- 22) Ravindran, P., Vajeeston, P., Vidya, R., Kjekshus, A. and Fjellvag, H.:

Phys. Rev. B, 64, 224509 (2001)

- 23) Kresse, G. and Hafner, J.: *Phys. Rev. B*, 47, 558 (1993); *Phys. Rev. B*, 49, 14251 (1994); Kresse, G. and Furthmüller, J.: *Comput. Mat. Sci.*, 6, 15 (1996); *Phys. Rev. B*, 54, 11169 (1996)
- 24) Zhu, Y., Moodenbaugh, A.R., Schneider, G., Davenport, J.W., Vogt, T., Li, Q., Gu, G., Fischer, D.A. and Tafto, J.: *Phys. Rev. Lett.*, 88, 247002 (2002).
- 25) Klie, R.F., Zhu, Y., Schneider, G. and Tafto, J.: *Appl. Phys. Lett.*, 82, 4316 (2003)
- 26) Klie, R.F., Zheng, J.C., Zhu, Y., Zambano, A.J. and Cooley, L.D.: *Phys. Rev. B*, 73, 014513 (2006)
- 27) Jiang, N., Jiang, B., Spence, J.C.H., Yu, R.C., Li, S.C. and Jin, C.Q.: *Phys. Rev. B*, 66, 172502 (2002)
- 28) Herman, F., Kawasaki, R.V. and Hsu, W.Y.: Phys. Rev. B, 38, 1, 204–207 (2003)
- 29) 齋藤 晃, 永坂圭祐,田中信夫: グラファイト K 殻励起をとも なう電子線非弾性散乱強度の3次元分布観察,日本顕微鏡学会 第63回学術講演会,2007年5月20日~22日,新潟.
- 30) たとえば, 鐸木啓三・菊池 修:電子の軌道, 共立出版.
- 31)たとえば、シッフ:量子力学、上、吉岡書店、朝永振一郎:角 運動量とスピン、みすず書房、ガシオロウィッツ:量子力学、 Ⅰ、Ⅱ(丸善).